

# НАСЫЩЕНИЕ ЭКСИТОННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНЫХ КВАНТОВЫХ ЯМАХ GaAs/AlGaAs ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ

© В.Н.Григорьев, В.И.Гринев, В.Л.Литвиненко,  
В.Г.Лысенко, Н.И.Першикова, И.М.Хвам\*

Институт проблем проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук,

142432 Черноголовка, Московская обл., Россия

\* Центр микроэлектроники, Датский технический университет, Лингби, Д-2800, Дания

(Поступила в Редакцию 7 июня 1995 г.)

В однолучевом эксперименте исследована трансформация экситонного резонанса в спектрах поглощения многослойных квантовых ям GaAs/AlGaAs при увеличении уровня фемтосекундного лазерного возбуждения. В интервале плотностей электронно-дырочных пар ( $1.6 \cdot 10^9 - 2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$ ) обнаружено сильное просветление линий поглощения состояний экситонов с тяжелой (ННХ) и легкой (ЛНХ) дыркой при незначительном уширении. Наблюдаемые закономерности связываются с уменьшением эффективной силы осциллятора экситонного перехода вследствие заполнения фазового пространства одночастичных состояний. Получена оценка величины параметра насыщения силы осциллятора  $N_s = 1.9 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$ .

Повышенный интерес к исследованиям механизмов межчастичных взаимодействий, приводящих к большим величинам оптических нелинейностей в кванто-размерных структурах, связан, в частности, с возможностями использования последних в переключающих, логических и нелинейных элементах систем обработки информации [1]. Одной из фундаментальных нелинейностей является насыщение экситонного поглощения, выражющееся в уменьшении величины коэффициента оптического поглощения  $\alpha$  в максимуме линии при увеличении плотности электронно-дырочных ( $e-h$ ) пар [2]. Вклад нижайшего  $1s$ -экситонного состояния в диэлектрическую проницаемость квантовой ямы (КЯ)  $\delta\epsilon_{ex}(\hbar\omega)$  можно представить в виде

$$\delta\epsilon_{ex}(\hbar\omega) = \frac{F_{ex} \sum (1 - f_e - f_h) \hbar\omega_{ex}}{SL_z [(\hbar\omega_{ex})^2 - (\hbar\omega)^2 - i\gamma_{ex}\hbar\omega]}, \quad (1)$$

где  $\hbar\omega_{ex}$  — энергия экситонного состояния,  $\gamma_{ex}$  — параметр его затухания,  $f_e$  и  $f_h$  — числа заполнения одночастичных электронных и

дырочных состояний,  $\sum$  обозначает суммирование по всем значениям квазимпульса,  $S$  — площадь КЯ,  $L_z$  — ее толщина,  $F_{\text{ex}}$  — сила осциллятора экситонного перехода в расчете на одну ячейку [3].

$$F_{\text{ex}} = \Omega |\Phi(0)|^2 f_0 / L_z. \quad (2)$$

Здесь  $\Phi(r_e - r_h)$  — волновая функция, описывающая относительное движение электронов и дырок в плоскости ямы,  $|\Phi(0)|^2$  — вероятность обнаружить электрон и дырку в одной ячейке,  $f_0$  — квадрат матричного элемента дипольного перехода между блоховскими состояниями в подзонах,  $\Omega$  — объем элементарной ячейки.

При увеличении плотности  $(e-h)$ -пар экситонные оптические переходы могут обнаруживать сдвиг частоты  $\omega_{\text{ex}}$ , увеличение параметра экситонного затухания  $\gamma_{\text{ex}}$  или уменьшение эффективной силы осциллятора  $F^{\text{ef}} = (F_{\text{ex}}/SL_z) \sum (1 - f_e - f_h)$ . Как видно из (1), все три названных эффекта вносят вклад в изменения величины  $\alpha(\hbar\omega) \sim \omega \operatorname{Im} \delta\varepsilon_{\text{ex}}(\hbar\omega)$  и в принципе могут привести к просветлению экситонного резонанса.

Так, к увеличению параметра экситонного затухания  $\gamma_{\text{ex}}$  и уширению линии поглощения при уменьшении ее величины в максимуме и неизменности интегрального поглощения могут привести усиление межэкситонного рассеяния при увеличении плотности экситонов [4] или экранирование кулоновского взаимодействия в системе носителей высокой плотности [5]. С другой стороны, из-за перекрытия волновых функций возможны расщепление и сдвиг энергии экситонных состояний  $\hbar\omega_{\text{ex}}$ , так что экситонный уровень трансформируется в неоднородно уширенную полосу (например, Гауссов контур) с полушириной  $\Gamma$ . В этом случае форма линии будет описываться сложным Лорентц-Гауссовым контуром [6].

При увеличении плотности экситонов уменьшение эффективной силы осциллятора может быть, в частности, связано с уменьшением «площади когерентности» экситона  $A_c \sim 1/\gamma_{\text{ex}}$ , т. е. той части пространства, где волновая функция экситона сохраняет фазу [3]. В этом случае оно сопровождается уменьшением времени фазовой релаксации  $T_2$  и соответствующим увеличением параметра экситонного затухания  $\gamma_{\text{ex}}$ . Как следует из (1), прямой вклад в уменьшение  $F^{\text{ef}}$  может внести заполнение фазового пространства (ЗФП) одночастичных состояний, при этом для части экситонных состояний переход становится запрещенным. Еще одной возможной причиной уменьшения  $F^{\text{ef}}$ , как видно из соотношения (2), являются ренормализация экситонной орбитальной волновой функции и соответствующее уменьшение вероятности  $|\Phi(0)|^2$  в присутствии других  $(e-h)$ -пар. Наибольший вклад в последний эффект вносит, по-видимому, обменное взаимодействие [7,8].

Относительный вклад различных механизмов изменений параметров экситонного резонанса в наблюдаемые трансформации линии поглощения может зависеть от соотношения длительности импульсов фотовозбуждения, характерных времен соответствующих механизмов и величины задержки относительно момента возбуждения. Так, уширение вследствие межэкситонного рассеяния происходит за времена  $10^{-11}-10^{-13}$  с в зависимости от плотности экситонов, экранирование кулоновского взаимодействия происходит за времена  $10^{-11}-10^{-13}$  с,

определенные плазменной частотой. Поэтому в экспериментах с импульсамиnano- и пикосекундной длительностей выделить вклады этих механизмов достаточно сложно. Так, в работах по трансформации экситонных линий поглощения в CdS [9] и GaAs [10] полученные результаты рассматриваются с точки зрения экранирования кулоновского взаимодействия в системе носителей высокой плотности. Очевидно, однако, что за наносекундные времена [9] или при временной задержке 8 ps [10] успевает произойти не только фазовая релаксация, сопровождающаяся уширением  $\gamma_{\text{ex}}$  и соответствующим уменьшением эффективной силы осциллятора, но и увеличение неоднородного уширения экситонного уровня  $\Gamma$ , приводящее к несимметричной полосе с полушириной около 10 meV.

В работах [11,12] по трансформации линий экситонного поглощения в КЯ, выполненных с использованием импульсов пикосекундной длительности, просветление резонансов связывается с уширением линии вследствие межчастичных столкновений и экранирования кулоновского взаимодействия соответственно. В то же время данные работы [13], использующей импульсы субпикосекундной длительности, интерпретировались с точки зрения уменьшения силы осциллятора вследствие заполнения состояний. Недавно в [5] сделан вывод о том, что уширение линии вследствие экранирования кулоновского взаимодействия является доминирующим механизмом просветления в области относительно низких плотностей ( $e - h$ )-пар (до  $10^{10} \text{ cm}^{-2}$  в расчете на каждую из КЯ), в то время как в области более высоких плотностей уменьшение интегрального поглощения связано с уменьшением силы осциллятора при заполнении фазового пространства. С нашей точки зрения, эксперименты с использованием двухлучевой методики, когда возбуждающие фотонны имеют волновой вектор  $K_1$ , а зондирующие  $K_2$  [5,11,12], в силу чисто методической ограниченности могут дать информацию преимущественно об уширительных механизмах просветления. Влияние ЗФП должно наиболее сильно проявляться в условиях однолучевого эксперимента, когда возбуждающие и зондирующие фотонны имеют одинаковые энергии, волновые векторы и поляризации. В связи с вышеизложенным целью настоящей работы являлось исследование в однолучевом эксперименте особенностей трансформации экситонной линии поглощения в многослойных КЯ (МКЯ) GaAs/AlGaAs при увеличении уровня фемтосекундного лазерного возбуждения в области относительно низких плотностей создаваемых электронно-дырочных пар.

Исследования проводились на структурах с двадцатью КЯ GaAs/AlGaAs толщиной 100 Å, разделенных барьерами толщиной 150 Å, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Для исследований спектров пропускания подложка в окне ( $1 \times 1 \text{ mm}^2$ ) удалялась селективным травлением. Для исследований трансформации спектров пропускания использовалось излучение перестраиваемого титан-сапфирового лазера с длительностью импульса около 150 fs и полушириной спектра излучения около 30 meV. Исследования проводились в оптическом криостате при температуре паров гелия 5 K. В качестве фотоприемника служила линейка фотодиодов оптического многоканального анализатора. Излучение лазера фокусировалось на поверхности структуры в пятно диаметром 30 μm. Мощность возбуждающего излучения изменялась с помощью нейтральных светофильтров.

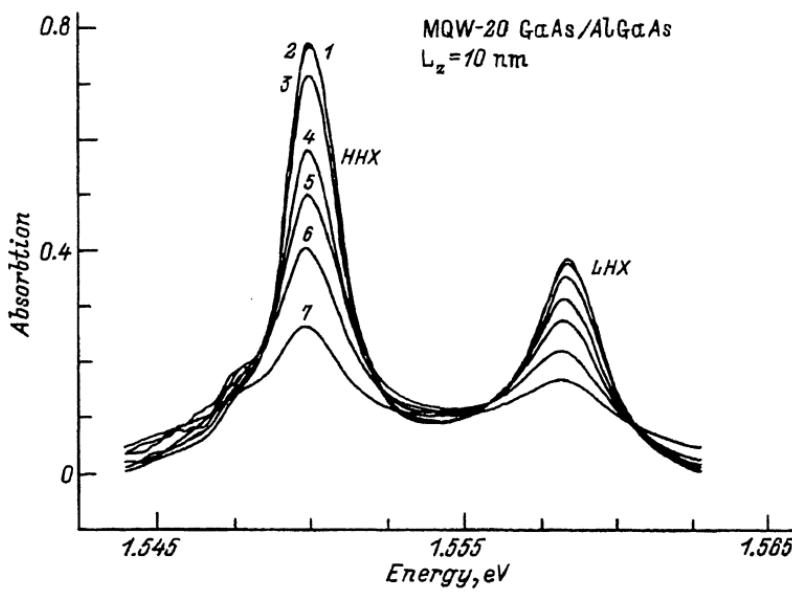


Рис. 1. Спектры поглощения МКЯ при различных плотностях

$N (10^{10} \text{ cm}^{-2})$ : 1 — 0.035, 2 — 0.16, 3 — 0.27, 4 — 0.75, 5 — 1.3, 6 — 2, 7 — 2.9.

тров в интервале  $10^{-5}$ — $10^{-1}$  W, чему при частоте следования лазерных импульсов 70 MHz отвечала плотность энергии от  $10^{-9}$  до  $10^{-5}$  J/cm<sup>2</sup> в одном импульсе в расчете на каждую из КЯ структуры. Фактическая задержка между возбуждающими и зондирующими фотонами не превышала ширины лазерного импульса 250 fs. Плотность  $N$  создаваемых в структуре ( $e - h$ )-пар вычислялась из поглощаемой в ней энергии, которая определялась из измеренных спектров падающей и прошедшей мощностей посредством соответствующего вычитания и интегрирования по спектру. Часть поглощаемой в структуре энергии не превышала 16% при совпадении положений максимумов спектра лазерного излучения и линии поглощения экситонов в тяжелой дыркой. Величина случайной погрешности в определении плотности ( $e - h$ )-пар возрастает с увеличением плотности из-за ошибок в вычитании спектров, а также вследствие нестабильности лазера, и при плотностях ( $e - h$ )-пар более  $3 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$  достигает 50%. Однако, как будет видно далее, наиболее существенные результаты получены в области более низких плотностей.

В спектрах линейного поглощения исследуемых структур, полученных с помощью галогенной лампы, наблюдаются резкие линии поглощения 1.550 и 1.558 eV с полушириной 1.5 meV, отвечающие экситонам первых электронной и дырочной подзон размерного квантования с тяжелой (линия HNX) и легкой (линия LHX) дырками соответственно. Трансформация экситонного резонанса в спектрах поглощения исследовалась при различных положениях максимума спектра лазерного излучения относительно линий HNX и LHX, что позволяло продвинуться в область низких плотностей ( $e - h$ )-пар до  $10^8 \text{ cm}^{-2}$ . Как видно из рис. 1, при плотностях  $N$  вплоть до  $1.6 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2}$  энергия экситонного состояния, полуширина линии поглощения и ее величина в максимуме не претерпевают заметных изменений. Начиная с плотностей

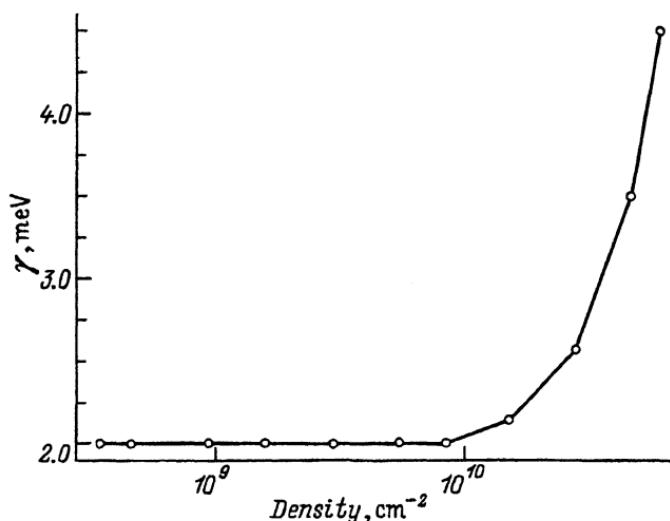


Рис. 2. Зависимость полуширины  $\gamma$  линии поглощения ННХ от плотности электронно-дырочных пар.

около  $2 \cdot 10^9 \text{ см}^{-2}$ , с ростом плотности пар наблюдается возрастающее просветление линий ННХ и ЛНХ при неизменной энергии экситонного состояния  $\hbar\omega_{\text{ex}}$  и незначительным уширением линий  $\gamma$  вплоть до плотностей  $(e - h)$ -пар  $2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$  (спектры 3–6). При плотностях пар выше  $3 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$  уменьшение величины  $\alpha$  в максимуме линии и интегрального поглощения (спектр 7) сопровождается увеличением полуширины линии  $\gamma$  (рис. 2).

Наблюдаемые нами в однолучевом эксперименте особенности трансформации экситонного состояния при увеличении уровня фемтосекундного лазерного возбуждения, представленные на рис. 1, 2, качественно отличаются от наблюдавшихся ранее в объемных полупроводниках и КЯ в двухлучевых экспериментах с импульсами наносекундной [9], пикосекундной [ $10^{-12}$ ] и фемтосекундной длительностей в соответствующей области плотностей  $(e - h)$ -пар [5]. Сильное просветление резонанса при пренебрежимо малом изменении полуширины линии  $\gamma$  в интервале плотностей пар  $1.6 \cdot 10^9$ – $2 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$  свидетельствует от уменьшении эффективной силы осциллятора экситонного перехода, которое нельзя отнести за счет увеличения параметра экситонного затухания  $\gamma_{\text{ex}}$  или неоднородного уширения экситонного уровня Г. Как отмечалось выше, в условиях однолучевого эксперимента наиболее вероятной причиной уменьшения величины силы осциллятора с ростом уровня возбуждения нам представляются заполнение фазового пространства одночастичных состояний и соответствующаяrenomализация экситонной орбитальной волновой функции вследствие обменного взаимодействия. Вклад кулоновского экранирования в уменьшение силы осциллятора пренебрежимо мал по сравнению с ЗФП и обменом [7]. Уширение линии при уменьшении интегрального поглощения в области плотностей  $(e - h)$ -пар выше  $3 \cdot 10^{10} \text{ см}^{-2}$  свидетельствует, по-видимому, о включении механизма фазовой релаксации, связанного с межэкситонным рассеянием, что одновременно должно приводить и к уменьшению силы осциллятора.

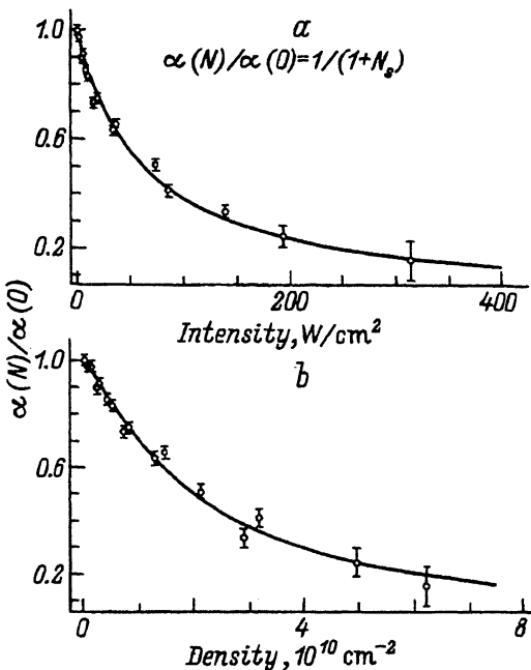


Рис. 3. Зависимости относительного просветления в максимуме линии ННХ от плотности падающей на структуру мощности (a) и плотности электронно-дырочных пар (b).

Из представленной на рис. 3, а зависимости относительного изменения величины коэффициента поглощения  $\alpha$  в максимуме линии ННХ от плотности падающей на структуру мощности, которая имеет вид, типичный для насыщения поглощения, мы определили величину параметра интенсивности насыщения  $I_s = 66 \text{ W/cm}^2$  и оценили величину коэффициента нелинейного поглощения структуры  $\alpha_2 \cong 315 \text{ cm/W}$ . Величина нелинейности существенно превосходит наблюдавшуюся ранее, например, в [11] в условиях двухлучевого эксперимента, что свидетельствует, по-видимому, о включении более эффективного, чем уширение линии, механизма насыщения.

В пренебрежении несущественным эффектом уширения величина относительного изменения величины силы осциллятора экситонного перехода  $F^{\text{ef}}(N)/F^{\text{ef}}(0)$  равна величине относительного изменения коэффициента поглощения  $\alpha$  в максимуме линии  $\alpha(N)/\alpha(0)$ . Соответствующая зависимость, представленная на рис. 3, б, наилучшим образом описывается эмпирическим соотношением  $\alpha(N)/\alpha(0) = 1/1 + (N/N_s)^{1.3}$  с параметром половинного насыщения силы осциллятора  $N_s = 1.9 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ . Согласно развитой в [7] теории для двумерного экситонного газа, половинное насыщение силы осциллятора должно иметь место при достижении плотности пар  $1/16\pi a_0$ , что соответствует среднему межчастичному расстоянию  $\sim 7a_0$ , где  $a_0$  — боровский радиус экситона. Найденному нами значению величины параметра насыщения соответствует среднее межчастичное расстояние 725 Å. Последнее находится в соответствии с данными работ по характеризации качества интерфейса в МКЯ методом фотолюминесценции [14].

Таким образом, проведенное нами по однолучевой методике исследование трансформации экситонного состояния в спектрах поглощения МКЯ при увеличении уровня фемтосекундного лазерного возбуждения позволило уже в области относительно низких плотностей электронно-дырочных пар зарегистрировать качественно новые особенности трансформации линии поглощения, однозначно свидетельствующие об уменьшении эффективной силы осциллятора экситонного перехода. Последнее, по-видимому, связано с ЗФП одночастичных состояний. Полученные результаты позволяют по-новому взглянуть на результаты ряда ранее опубликованных работ по трансформации экситонных резонансов с ростом уровня возбуждения в объемных полупроводниках и КЯ.

Работа выполнена в рамках программ «Физика твердотельных nanoструктур» и «Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники» при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 95-02-05046).

### Список литературы

- [1] Smith P.J. Bell Syst. Techn. J. **61**, 8, 1975 (1982).
- [2] Henneberger F. Phys. Stat. Sol. (b) **137**, 2, 371 (1986).
- [3] Feldman J., Peter G., Gobel E.O., Dawson P., Moore K., Foxon C., Elliot R.J. Phys. Rev. Lett. **16**, 20, 2337 (1987).
- [4] Schultheis L., Kuhl J., Honold A., Tu C.W. Phys. Rev. Lett. **57**, 14, 1635 (1986).
- [5] Hunsche S., Leo K., Kurz H., Kohler K. Phys. Rev. B **49**, 23, 16565 (1994).
- [6] Humlček J., Schmidt E., Bocanek L., Svehla R., Ploog K. Phys. Rev. B **48**, 8, 5241 (1993).
- [7] Schmitt-Rink S., Chemla D.S., Miller D.A.B. Phys. Rev. B **32**, 10, 6601 (1985).
- [8] Zimmermann R. Phys. Stat. Sol. (b) **146**, 1, 371 (1988).
- [9] Lysenko V.G., Revenko V.I. Sov. Phys. Sol. St. **20**, 7, 1238 (1978).
- [10] Fehrenbach G.W., Schafer W., Treusch J., Ulbrich R.G. Phys. Rev. Lett. **49**, 17, 1281 (1982).
- [11] Chemla D.S., Miller D.A.B., Smith P.W., Gossard A.C., Wiegmann W. IEEE J. Quant. El. **QE-20**, 3, 265 (1984).
- [12] Wake D.R., Yoon H.W., Wolf J.P., Markoc H. Phys. Rev. B **46**, 20, 13452 (1992).
- [13] Knox W.H., Fork R.L., Downer M.C., Miller D.A.B., Chemla D.S., Shank C.V., Gossard A.C., Wiegmann W. Phys. Rev. Lett. **54**, 12, 1306 (1987).
- [14] Reynolds D.C., Bajaj K.K., Litton C.W., Yu P.W., Singh J., Masselink W.T., Fischer R., Markoc H. Appl. Phys. Lett. **46**, 1, 51 (1985).